

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงวิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีโซลเจล การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไโคอกไซด์ การศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไโคอกไซด์ และ แนวทางการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

อุปกรณ์และเครื่องมือในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) ส่วนการเตรียมฟิล์มบาง และ (2) ส่วนศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม และ (3) ส่วนศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง ดังนี้

##### 1. ส่วนการเตรียมฟิล์มบาง

1.1 เครื่องเคลือบแบบจุ่มเคลือบ (Dip Coating) ของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาการและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-1)

##### 1.2 เตาอบฟิล์ม (ภาพที่ 3-2)

1.2 สารตั้งต้น คือ ไทยเนี่ยมเตคระ ไอโซโพรพอกไซด์ เอทานอลและกรดอะซิติก

1.3 วัสดุรองรับ (Substrate) คือ กระดาษไวนิล

##### 2. ส่วนการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม

2.1 X-Ray Diffractrometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-Ray Diffractrometer (Bruker รุ่น D8) (ภาพที่ 3-3)

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนาและลักษณะพื้นผิว งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น SEIKO Instrument SPI4000 (ภาพที่ 3-4)

2.3 Optical Microscope สำหรับศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ใช้เครื่อง OLYMPUS รุ่น BX50 (ภาพที่ 3-5)

2.4 Roughness Tester สำหรับศึกษาความหนาของฟิล์ม ยี่ห้อ Mitutoyo (ภาพที่ 3-6)

##### 3. ส่วนศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง

3.1 เครื่องวัดมุมสัมผัส (ภาพที่ 3-7 (a))

3.2 ชุดข่ายแสงอัลตราไวโอเลต (ภาพที่ 3-7 (b))



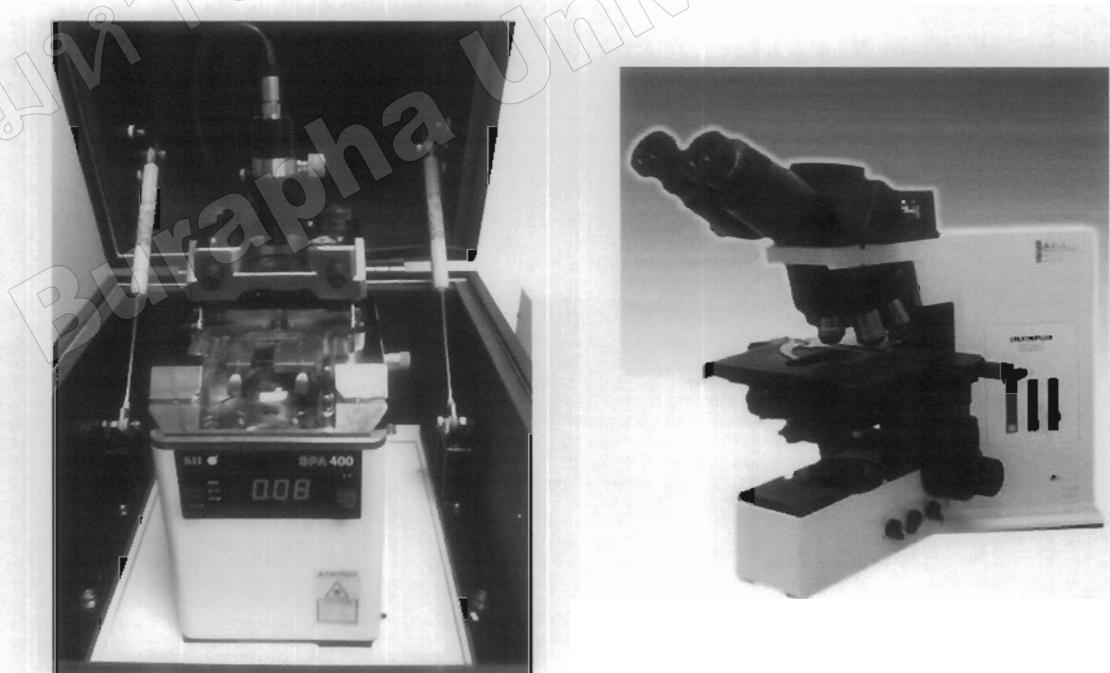
ภาพที่ 3-1 เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบจุ่นเคลือบ



ภาพที่ 3-2 เตาอบฟิล์ม



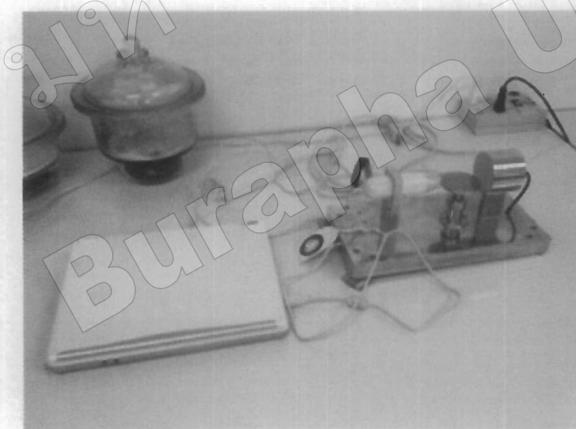
ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD)



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)      ภาพที่ 3-5 เครื่อง Optical Microscope



ภาพที่ 3-6 เครื่อง Roughness Tester



(a)



(b)

ภาพที่ 3-7 ชุดทดสอบสมบัติไฟฟ้าฟลิกวัคnumสัมผัส

(a) เครื่องวัดnumสัมผัส

(b) ชุดฉายแสงอัลตราไวโอเลต

### การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบ ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบผุน คราบไขมัน สารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ผิuwัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยอะซิโตน เป็นเวลา 10 นาที และนำไปล้างต่อด้วยไอโอดีฟานอล อีก 10 นาที และนำไปเช็ดในสารละลายกรดไนตริก 3% อีก 1 ชั่วโมง นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมคีบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จนน้ำวัสดุรองรับเก็บในภาชนะเพื่อรอการเคลือบดังแสดงในภาพที่ 3-8



ภาพที่ 3-8 การล้างวัสดุรองรับ

## การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีโซลเจล

งานวิจัยนี้เคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ (Dip Coating) จากสารเคลือบที่เตรียมด้วยวิธีโซลเจล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

### 1. การเตรียมสารเคลือบด้วยวิธีโซลเจล

1.1 เริ่มจาก ละลาย ไททาเนียมเตตราไซด์ ในตัวทำละลาย เอทานอล โดยให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.47 มोลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง โดยกวนสารด้วยเครื่อง Magnetic Stirrer

1.2 ปรับ pH ของสารละลาย ไททาเนียมเตตราไซด์ ในตัวทำละลาย เอทานอล โดยเติมกรดแอซิติก ให้อยู่ในสภาวะกรด (พีเอช ~ 2-3) โดยตรวจสอบ ด้วยการเทียบ สีของกระดาษลิตมัส

1.3 เมื่อได้สารละลาย ไททาเนียมเตตราไซด์ ในตัวทำละลาย เอทานอล ที่มีสภาวะกรดตามต้องการแล้ว กวนสารละลายต่ออีกนาน 1 ชั่วโมง

### 2. การเคลือบฟิล์มด้วยวิธีจุ่มเคลือบ

2.1 เตรียมสารเคลือบ ที่เตรียมไว้ใส่ในบิกเกอร์ วางในตู้แห้งวางสารเคลือบของ เครื่องเคลือบ จากนั้นกำหนดค่าอัตราเร็วของการจุ่มเคลือบ ที่ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง เคลือบ

2.2 นำวัสดุรองรับ (กระჯัส ไอล์ด) ติดตั้งที่ชุดจับชิ้นงานของเครื่องเคลือบ

2.3 กดสวิทช์ ให้เครื่องเริ่มจุ่มชิ้นงานลงในสารละลายเคลือบ ตามที่กำหนด

2.4 เมื่อชิ้นงานถูกดึงขึ้นจากสารละลายจนสุด เครื่องจะหยุด ให้นำชิ้นงานออกจาก ชุดจับชิ้นงาน แล้วนำไปอบด้วยเตาอบฟิล์ม ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

2.5 นำชิ้นงานที่อบແล็ก กลับมาติดที่ชุดจับชิ้นงานแล้ว กลับไปทำ ข้อ 2.3-2.5 จน ครบจำนวนชั้นของฟิล์มที่ต้องการ แล้ว นำไปอบด้วยเตาอบฟิล์ม ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง

2.6 ร่อนอุณหภูมิในเตาอบฟิล์มลดลงจนเท่ากับ อุณหภูมิห้อง จึงนำฟิล์มออกจาก เตาอบ ตรวจเช็คลักษณะทางกายภาพเบื้องต้น ก่อนนำเก็บเข้ากล่องเตรียมวิเคราะห์ต่อไป

## การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์

การวิเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มไททาเนียมไคออกไซด์ที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย โครงสร้างผลึกขนาดผลึกค่าคงที่แลดทิช ลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหยาบผิว ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้

### 1. การศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์มีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์โดยนำฟิล์มที่เคลือบนบนแผ่นกระดาษน้ำทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์ที่เกิดขึ้น โดยจะใช้  $\text{Cu}-\text{k}\alpha$  เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ กำหนดค่ามุมวัดอยู่ในช่วง  $20^\circ - 80^\circ$  สถาปัตยกรรมที่วัดได้บันทึกในรูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ เปรียบเทียบค่ามุม  $2\theta$  ที่ตำแหน่งความเบื้องสูงสุดกับมาตรฐานขององของแฟ้ม JCPDS เพื่อหารูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้

1.2 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคอออกไซด์สามารถหาได้จากการคำนวณรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการของ Scherrer สมการที่ 3-1 ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไคอออกไซด์ที่ได้หลังการเคลือบ

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (3-1)$$

เมื่อ  $L$  คือ ขนาดของผลึกฟิล์มไททาเนียมไคอออกไซด์

$k$  คือ ค่าคงที่เท่ากับ 0.94

$\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ( $\text{CuK}\alpha = 1.5406 \text{ \AA}$ )

$\beta$  คือ ความกว้างครึ่งหนึ่งของพีคที่มีค่าความเบื้องสูงสุด (FWHM)

$\theta$  คือ ครึ่งหนึ่งของมุมตรงกันข้ามของพีค

1.3 การหาค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มนางไททาเนียมโดยออกใช้ค่าจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการ การหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเตตระโภนอล ในการคำนวณหาค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มนางที่เคลือบได้

## 2. การศึกษาความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไททาเนียมโดยออกใช้ค์

การหาความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไททาเนียมโดยออกใช้ค์คัวยเทคนิค AFM โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นกระดาษไอล์ดที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาคัวยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิโคนในไ/drค์เคลือนที่ราดบนผิวฟิล์มนางเพื่อตรวจวัดความหนา และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ  $1 \times 1 \text{ } \mu\text{m}^2$  พร้อมวัดค่าความหนาผิว

### การศึกษาสมบัติไฮโลฟลิกของฟิล์มนางไททาเนียมโดยออกใช้ค์

สมบัติไฮโลฟลิกของฟิล์มนางที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ พิจารณาจากค่ามุนสัมผัสของหยดน้ำบนกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุรองรับ ซึ่งวัสดุมุนสัมผัสคัวยเครื่องวัสดุมุนสัมผัส โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นำกระดาษไอล์ดที่ต้องการวัดมุนสัมผัส วางบนแท่นวางชิ้นงานของเครื่องวัสดุมุน

2. บรรจุน้ำกลิ้นในหลอดฉีดยา ติดตั้งให้เข็มฉีดยาบนแท่นจับหลอดให้ปลายเข้มอยู่

ตรงกลางแนวแท่นวางชิ้นงาน

3. ใช้ไมโครมิเตอร์สำหรับดันหลอดฉีดยา ดันให้น้ำออกจากหลอดที่ปลายเข้มฉีดยา โดยทำการปรับขนาดทรงกลมจากการปรับระยะไมโครมิเตอร์เป็น 5 mm

4. ใช้ปุ่มปรับระดับปลายเข้มฉีดยา เลื่อนให้ปลายเข้มฉีดที่มีหยดน้ำเข้าหากกระดาษไอล์ด โดยให้หยดน้ำสัมผัสกับผิวของกระดาษพอดีจนเกิดหยดน้ำบนกระดาษไอล์ดที่ตำแหน่งใกล้ขอบกระดาษไอล์ดพอตี ปรับปลายเข้มยกขึ้น อ่านค่ามุนสัมผัสโดยมองจากเลขสีใกล้ตา บันทึกเป็นค่ามุนสัมผัส

## แนวทางการทดลอง

งานวิจัยนี้ แบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ดังนี้

การทดลองที่ 1 การเตรียมพิล์มนางไทยเนยน ไโคอกไซด์คั่วบีชจุ่มเคลือบ

วัสดุประสงค์ เพื่อหาอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มนางไทย  
เนยน ไโคอกไซด์เฟสตونةทส

### วิธีการทดลอง

1. การเคลือบพิล์มน ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มนางไทยเนยน ไโคอกไซด์บนกระ杰สไลด์คั่วบีชจุ่มเคลือบ จากสารเคลือบที่เตรียมคั่วบีชโซลเจล โดยเตรียมสารเคลือบโดยใช้ไทยเนยนเตตระไอโซโพพรอกไซด์ เป็นสารตั้งต้น โดยใช้โซหานอล เป็นตัวทำละลาย และใช้กรดแอกซิตริก ในการปรับ pH จากนั้นจึงนำกระ杰สไลด์มาจุ่มเคลือบ โดยแปรค่าอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบ 3 ท่า คือ 10 cm/min, 20 cm/min และ 30 cm/min

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มนที่ได้ โดยนำชิ้นงานที่ได้ไปศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ วัดความหนาด้วยเครื่อง Roughness Tester

การทดลองที่ 2 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มน ไทยเนยน ไโคอกไซด์

วัสดุประสงค์ เพื่อเตรียมพิล์มน ไทยเนยน ไโคอกไซด์ที่จำนวนชั้นต่าง ๆ และเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มนที่เคลือบได้

### วิธีการทดลอง

1. การเคลือบพิล์มน ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มนางไทยเนยน ไโคอกไซด์บนกระ杰สไลด์คั่วบีชจุ่มเคลือบ จากสารเคลือบที่เตรียมคั่วบีชโซลเจล โดยเตรียมสารเคลือบโดยใช้ไทยเนยนเตตระไอโซโพพรอกไซด์ เป็นสารตั้งต้น โดยใช้โซหานอล เป็นตัวทำละลาย และใช้กรดแอกซิตริก ในการปรับ pH จากนั้นจึงนำกระ杰สไลด์มาจุ่มเคลือบ โดยกำหนดให้อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบท่ากัน 20 cm/min และ แปรค่าจำนวนชั้นของพิล์มนที่เคลือบ

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มนที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึกค่าคงที่แลดทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

**การทดลองที่ 3 การวัดค่ามุนสัมผัสของพิล์มไททาเนียมโดยอุ่นไฟฟ้า**  
**วัสดุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของจำนวนชั้นพิล์มบางต่อสมบัติไฮโครฟลิก**

**วิธีการทดลอง**

1. การเคลือบพิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มบางไททาเนียมโดยอุ่นไฟฟ้า ประกอบด้วยวิธีจุ่มเคลือบ จากสารเคลือบที่เตรียมด้วยวิธีโซลเจล โดยเตรียมสารเคลือบโดยใช้ไททาเนียมเตตราไฮโดรฟอฟโรกไชค์ เป็นสารตั้งต้น โดยใช้เอทานอล เป็นตัวทำละลาย และใช้กรดแอกซิตริก ในการปรับ pH จากนั้นจึงนำกระถางไอล์ค์มาจุ่มเคลือบ โดยกำหนดให้อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบท่ากับ  $20 \text{ cm/min}$  และ ปริมาณจำนวนชั้นของพิล์มที่เคลือบ
2. การวัดค่ามุนสัมผัสของพิล์มที่เคลือบได้ นำพิล์มนี้ไปจาระรับแสงอัตตราไวโอเลตที่เวลาต่าง ๆ แล้วนำมาวัดค่ามุนสัมผัสด้วยเครื่องวัดมุนสัมผัส เพื่อประเมินสมบัติไฮโครฟลิกของพิล์มที่เคลือบได้